

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年6月3日(03.06.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/106460 A1

- (51) 国際特許分類:
C11D 7/26 (2006.01) *C11D 7/32* (2006.01)
C11D 7/30 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/039997
- (22) 国際出願日: 2020年10月23日(23.10.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-212251 2019年11月25日(25.11.2019) JP
- (71) 出願人: 昭和電工株式会社 (SHOWA DENKO K.K.) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門 1丁目13番9号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中崎 晋 (NAKAZAKI, Susumu); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP). 宮原 邦明 (MIYAHARA, Kuniaki); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING DECOMPOSING/CLEANING COMPOSITION

(54) 発明の名称: 分解洗浄組成物の製造方法

(57) Abstract: Provided is a method for producing a decomposing/cleaning composition which improves etching speed retention. A method for producing a decomposing/cleaning composition which contains (A) an N-substituted amide compound in which a hydrogen atom is not directly bonded to a nitrogen atom and (B) a quaternary alkyl ammonium fluoride or a hydrate thereof, said method having a preparation step for mixing the (A) and (B) components in an inert gas atmosphere.

(57) 要約: エッチング速度の保持率を改善する分解洗浄組成物の製造方法の提供。(A)窒素原子に水素原子が直接結合していないN-置換アミド化合物、及び(B)第四級フッ化アルキルアンモニウム又はその水和物、を含有する分解洗浄組成物の製造方法であって、前記(A)及び(B)を不活性ガス雰囲気下で混合する調製工程を有する、分解洗浄組成物の製造方法。



WO 2021/106460 A1